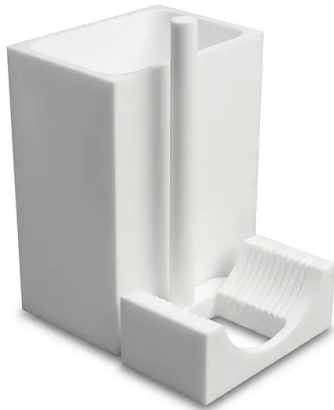


Cesto A Fiori Quadrato Personalizzabile In Ptfе Per La Pulizia Di Wafer Di Silicio Per Incisione In Processo Umido Semiconduttore E Movimentazione Di Substrati

Numero articolo: PL-CP88



introduzione

Cesti quadrati di pulizia in PTFE ad alta purezza progettati per la lavorazione di wafer di silicio. Questo supporto resistente alla corrosione garantisce sicurezza nell'incisione umida e nella movimentazione di substrati nella produzione di semiconduttori. Sono disponibili dimensioni e configurazioni completamente personalizzabili per soddisfare i requisiti specifici di banchi di lavorazione umida sia di laboratorio che industriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Fabbricazione di semiconduttori	Immersione di wafer di silicio in soluzioni di pulizia RCA o incisione Piranha per rimuovere i contaminanti.	Rischio zero di contaminazione metallica
Produzione di celle fotovoltaiche	Movimentazione di wafer solari di grande formato durante le fasi di texturizzazione e lucidatura acida.	Elevato volume di produzione e durabilità
Lavorazione di dispositivi MEMS	Trasporto sicuro di substrati microelettromeccanici delicati attraverso vari banchi di lavorazione umida.	Posizionamento preciso del substrato
Pulizia di vetro LCD/OLED	Pulizia di substrati di vetro conduttori (ITO/FTO) prima della deposizione di film sottili.	Resistenza chimica ai detergenti per vetro
Ricerca di laboratorio ad alta purezza	Supporto per campioni durante l'analisi di tracce e processi di digestione chimica aggressiva.	Resistenza superiore ai mezzi corrosivi
Substrati per nanotecnologia	Lavorazione di wafer su isolante (SOI) o di zaffiro in ambienti di ricerca.	Manipolazione delicata di materiali fragili

Categoria di specifica	Dettagli dei parametri per PL-CP88
Identificativo del modello	PL-CP88
Materiale principale	Politetrafluoroetilene (PTFE) ad alta purezza
Dimensioni standard	249mm x 249mm (Misure personalizzate disponibili su richiesta)
Geometria	Design a cesto a fiori con telaio quadrato
Opzioni di personalizzazione	Quantità di fessure, larghezza fessure, profondità fessure, passo e stile della maniglia
Intervallo di temperatura di esercizio	-200°C a +260°C
Resistenza chimica	Universale (eccetto metalli alcalini fusi e fluoro ad alta pressione)
Metodo di fabbricazione	Lavorazione di precisione CNC end-to-end per specifiche con alta tolleranza
Finitura superficiale	Finitura fluoropolimera liscia e non porosa

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Categoria di specifica	Dettagli dei parametri per PL-CP88	
Compatibilità	Vasche a immersione manuali e bracci robotizzati automatizzati per banchi di lavorazione umida	